

特許・技術調査レポート

Patent & Technology Research Report

特許ポートフォリオ分析

A株式会社

2012.11





CONTENTS



分析対象特許群について 2

第1章【全体俯瞰】 3

- ・ 出願件数の推移
- ・ ステータスの状態

第2章【注目技術分野の抽出】 4

- 2-1 近年の出願動向から注目技術分野を抽出 4
 - ・ 筆頭テーマコード別出願年推移
 - ・ 近年の注目技術分野
- 2-2 質の評価から注目技術分野を抽出 7
 - ・ 技術分類スコアマップ
 - ・ 個別特許の評価

第3章【注目技術分野別評価】 10

- ・ 技術分類スコアマップ経時変化
- ・ 出願年別評価
- ・ 経過情報の集計

第4章【審査官引用を用いた競合企業の把握】 13

- ・ 引用情報から見た注目企業
- ・ 引用情報から見た注目特許

第5章【参考資料】 15

- 5-1 パテントスコアについて 15
- 5-2 技術分類スコアマップについて 16
- 5-3 特許ポータル分類について 17
- 5-4 分析に用いたツール「Biz Cruncher」について 18

◆分析対象の特許群について

今回の分析にあたって1993年から2012年9月末までに公開された「A株式会社」の特許群を抽出し、調査を行った。

特許群については、2012年9月末時点でA株式会社が保有(失効、取り下げ等を含む)する特許2,228件を抽出。

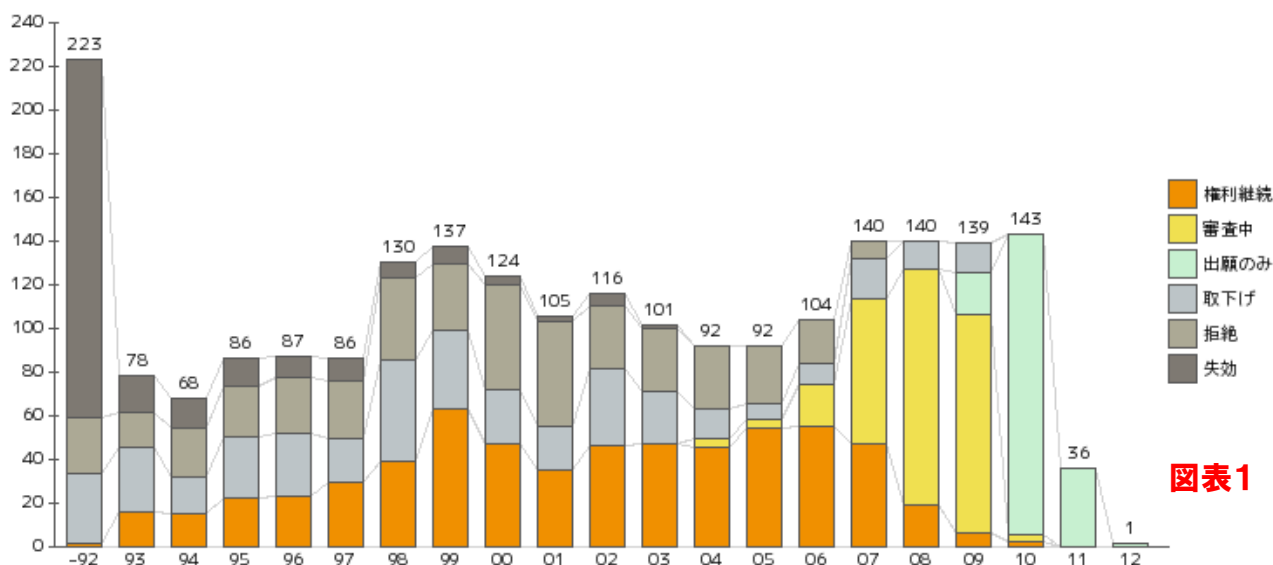
公開特許公報	:1993年1月～2012年9月
特許公告公報	:1994年1月～1996年6月
特許公報	:1996年5月～2012年9月
再公表特許公報	:1996年1月～2012年9月
公表特許公報	:1996年1月～2012年9月
整理標準化データ	:～2012年9月 (特許庁データ作成日)

第1章 全体俯瞰 統計分析

2000年前後から一時的に減少するも、2007年以降に再び増加

特許出願件数の出願年別推移を**図表1**に示す。

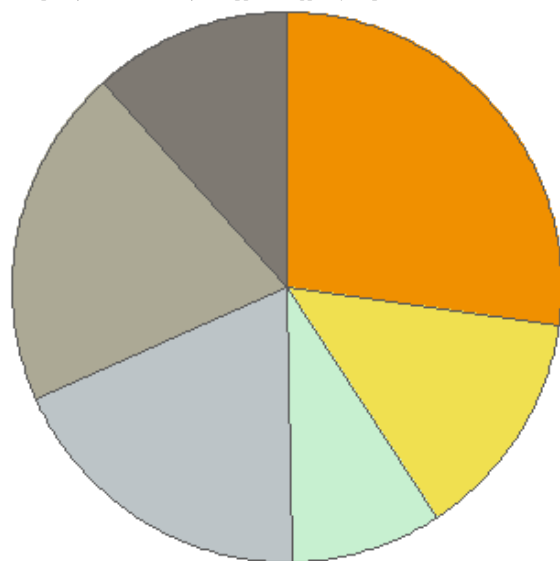
出願件数は2000年前後から減少傾向にあるが、2006年以降増加に転じ、2010年にはピークとなる143件の出願を行っている。(2011年以降の出願については未公開の状態のものが多数含まれているため暫定値)



図表1

図表2は全公報におけるステータスの状態を現したものである。

全公報2,226件のうち、194件(8.7%)が出願のみの状態、304件(13.6%)が審査請求済の段階、611件(27.4%)が権利継続中となっている。



合計: 2228件

図表2

ステータス	摘要
権利継続	審査で特許査定を受けたもので、まだ失効していない。
審査中	特許出願後、審査請求され審査中のもの。(審判中も含む。)
出願のみ	特許出願後、審査請求されていないもの。ただし、審査請求の期限を過ぎたものは見直し取下げと判断します。
取下げ	出願人による出願取下げ、または、特許出願後、審査請求されずに審査請求期間が過ぎたもの。出願却下・出願無効なども含む。
拒絶	特許出願後、審査請求され拒絶査定が確定したもの。(確定していると同推定できるものも含む。)
失効	特許登録後、権利満了や年金の不払いなどで失効したもの。無効審判や異議申立成立などで、特許登録後無効となったものも含む。

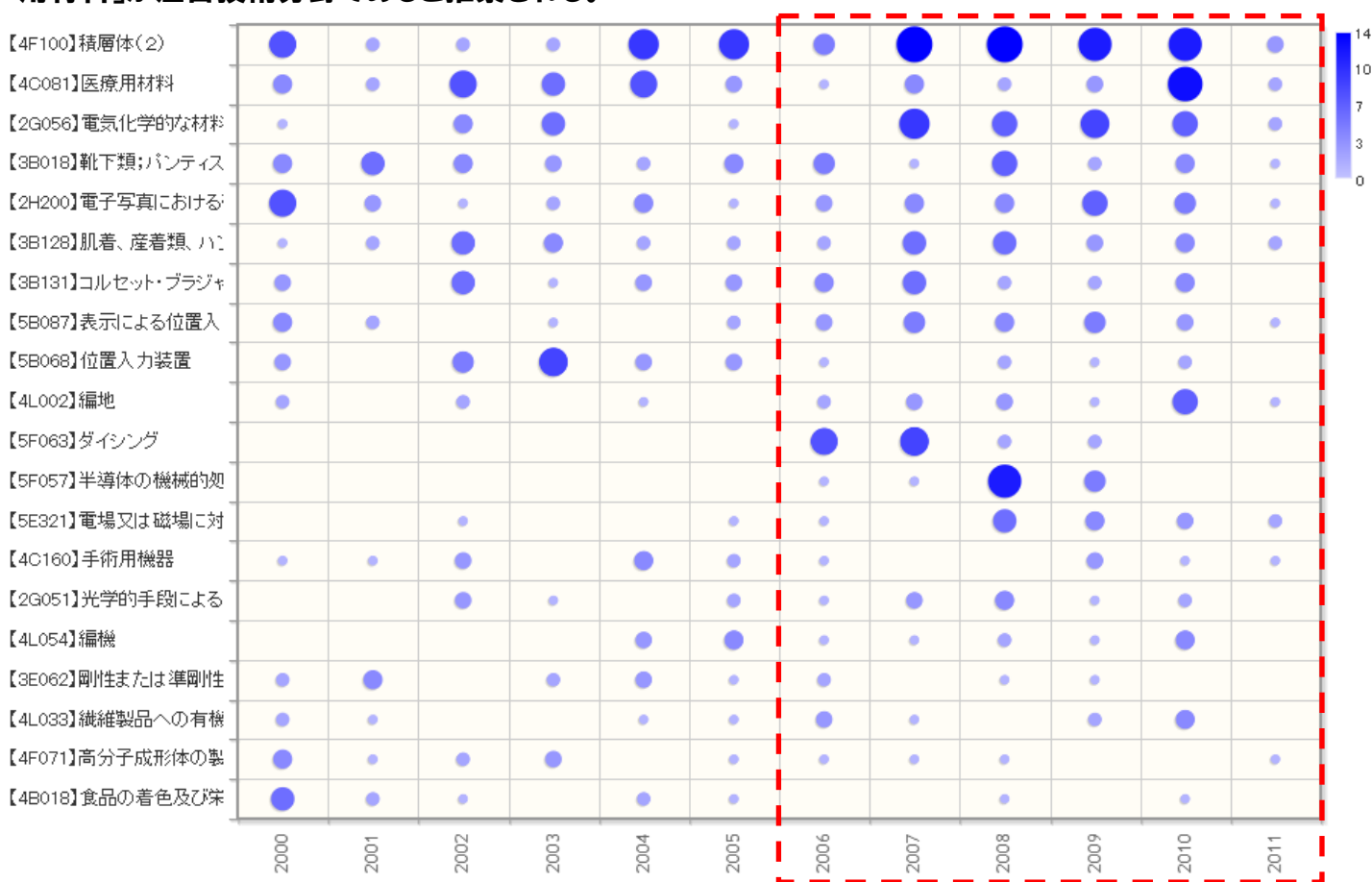
権利継続	611件	(27.4%)
審査中	304件	(13.6%)
出願のみ	194件	(8.7%)
取下げ	418件	(18.8%)
拒絶	445件	(20.0%)
失効	256件	(11.5%)

第2章 注目技術分野の抽出

2-1 近年の出願動向から注目技術分野を抽出

近年の注力分野は「積層体」「電気化学的な材料の調査、分析」「医療用材料」

図表3は2000年以降の出願における、A株式会社の筆頭テーマコード別の出願年別推移を表している(2000年以降の出願件数上位20分類)。直近5年間(未公開の公開特許情報を多く含む2011年は参考値とする)の出願で見ると、「4F100:積層体」「2G056:電気化学的な材料の調査、分析」「4C081:医療用材料」が注目技術分野であると推察される。

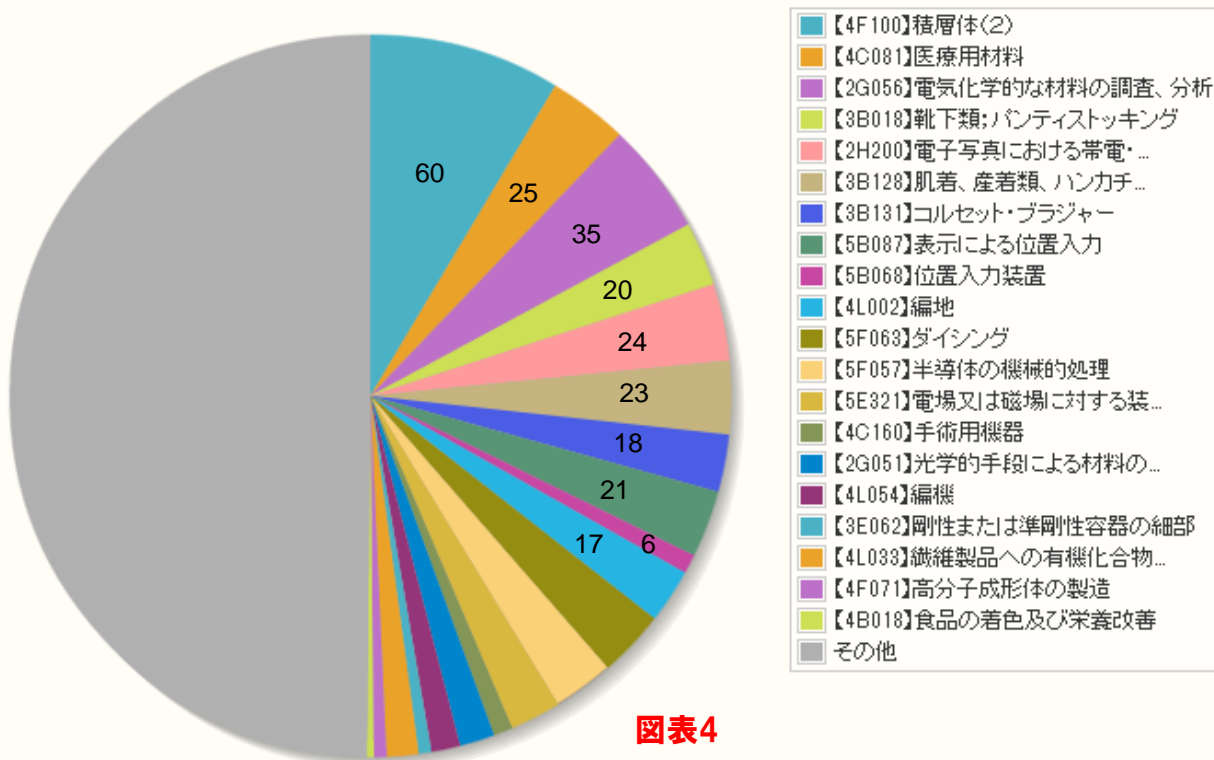


※各テーマの説明はp6を参照。

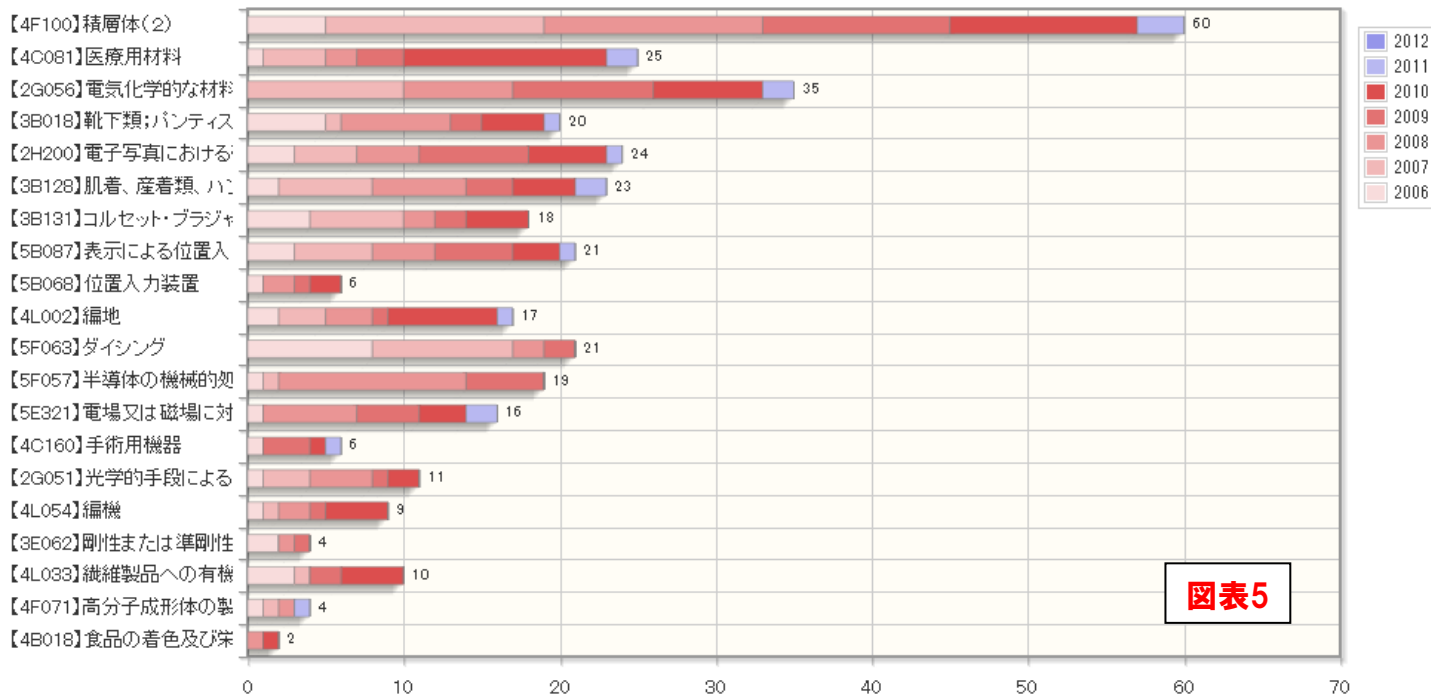
図表3

◆2006年以降の注目技術分野について

図表4は前頁赤枠で示された、2006年以降の出願における、A株式会社の筆頭テーマコード別の件数分布を表わしている。図表5は図表4で示された各テーマコードごとの出願年推移を示したものである。



図表4



図表5

※各テーマの説明はp6を参照。

【テーマコード上位20分類】

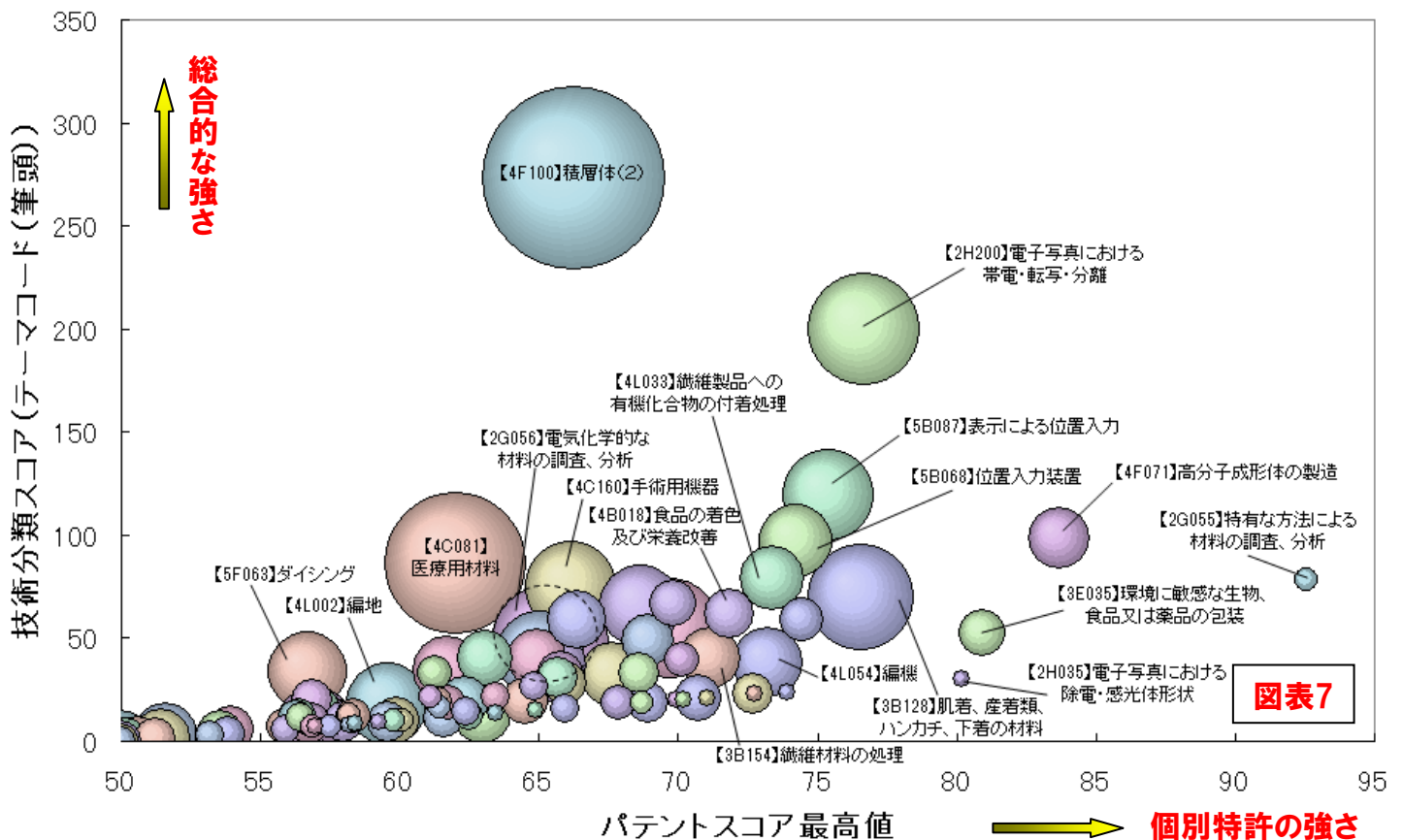
テーマコード	内容
4F100	積層体(2)
4C081	医療用材料
2G056	電気化学的な材料の調査、分析
3B018	靴下類; パンティストッキング
2H200	電子写真における帯電・転写・分離
3B128	肌着、産着類、ハンカチ、下着の材料
3B131	コルセット・ブラジャー
5B087	表示による位置入力
5B068	位置入力装置
4L002	編地
5F063	ダイシング
5F057	半導体の機械的処理
5E321	電場又は磁場に対する装置又は部品の遮蔽
4C160	手術用機器
2G051	光学的手段による材料の調査の特殊な応用
4L054	編機
3E062	剛性または準剛性容器の細部
4L033	繊維製品への有機化合物の付着処理
4F071	高分子成形体の製造
4B018	食品の着色及び栄養改善

図表6

2-2 パテントスコアの観点から注目技術分野を抽出

特許総合力上位は「積層体」「電子写真における帯電・転写・分離」「表示による位置入力」

図表7はパテントスコアの観点からみた技術分類スコアマップである(筆頭テーマコード毎の集計)。各技術分類の特許総合力を反映した技術分類スコア(縦軸)では、1位「4F100:積層体(2)」、2位「2H200:電子写真における帯電・転写・分離」、3位「5B087:表示における位置入力」となっており、これらは注目技術分野であると推察される。



(技術分類スコアマップについてはp16をご参照ください)

◆技術分類スコア上位20分類

順位	テーマコード(筆頭)	総合力	個別力	有効特許件数	出願件数
1	【4F100】積層体(2)	273.4	66.3	98	142
2	【2H200】電子写真における帯電・転写・分離	199.9	76.7	38	58
3	【5B087】表示による位置入力	119.0	75.4	25	38
4	【4F071】高分子成形体の製造	98.3	83.7	12	41
5	【5B068】位置入力装置	97.2	74.2	16	44
6	【4C081】医療用材料	86.3	62.0	59	92
7	【4L033】繊維製品への有機化合物の付着処理	79.4	73.4	13	24
8	【2G055】特有な方法による材料の調査、分析	78.1	92.6	2	2
9	【4C160】手術用機器	74.4	66.1	25	44
10	【3B128】肌着、産着類、ハンカチ、下着の材料	69.9	76.6	33	62
11	【3E067】包装体	66.6	69.8	7	22
12	【5E321】電場又は磁場に対する装置又は部品の遮蔽	65.4	68.6	20	25
13	【4B018】食品の着色及び栄養改善	61.8	71.9	8	21
14	【4L036】糸;糸またはロープの機械的な仕上げ	59.1	74.4	6	8
15	【4J002】高分子組成物	59.0	66.3	11	20
16	【3B018】靴下類;パンティストッキング	54.4	69.7	29	55
17	【3E035】環境に敏感な生物、食品又は薬品の包装	52.2	80.9	7	7
18	【4F205】型の被覆による成形、強化プラスチック成形	48.8	68.9	9	13
19	【2G056】電気化学的な材料の調査、分析	47.5	65.4	41	52
20	【3B131】コルセット・ブラジャー	41.6	65.0	23	57

図表8

特許個別力では「組織培養法並びにこれに用いる培養基材」が最高スコア

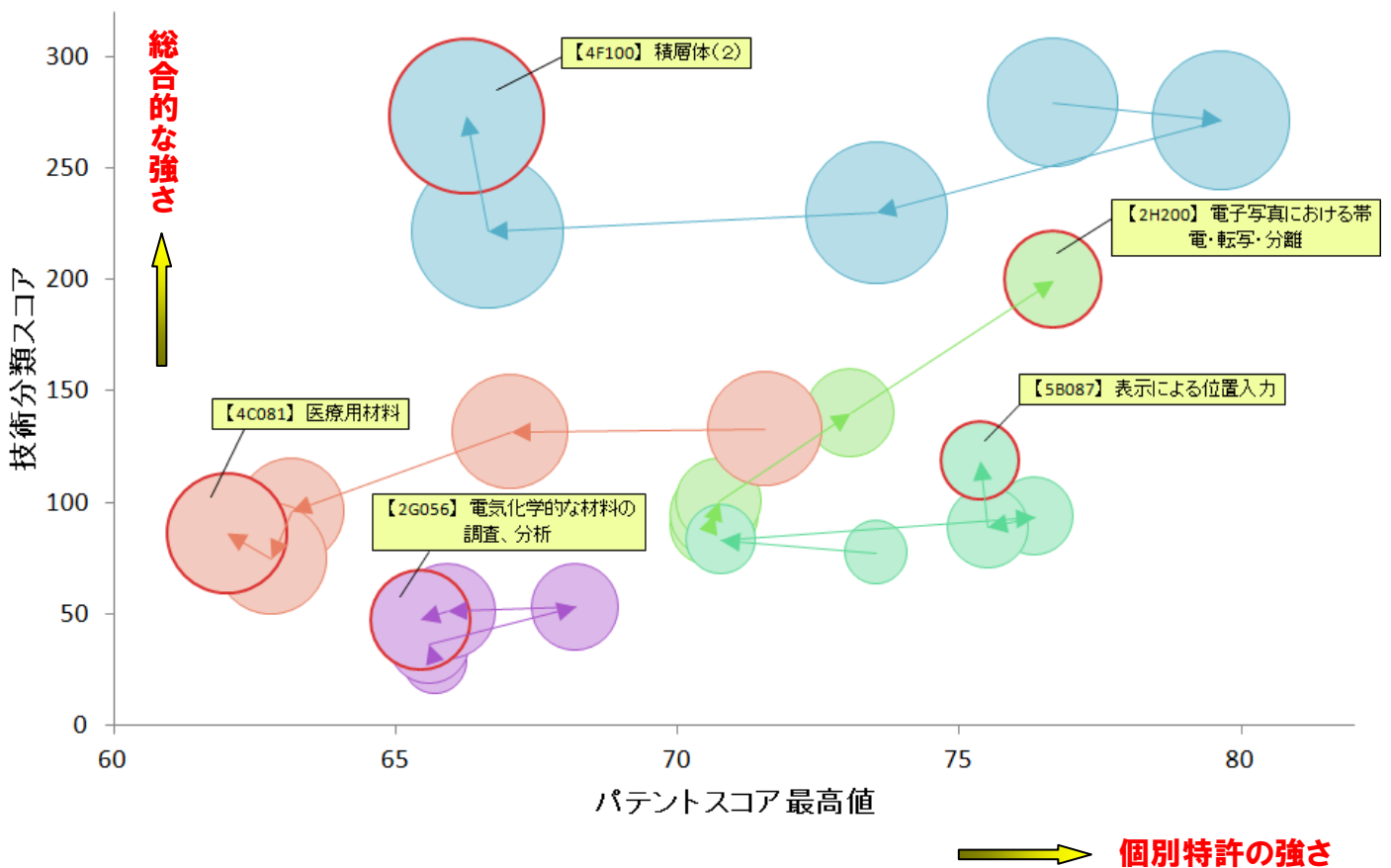
A株式会社の特許個別力(横軸)において、「組織培養法並びにこれに用いる培養基材」や、「皮膚刺激判定法」、「ラベル用低温熱収縮性フィルム」などが、高い注目度となっている(図表9)。

公報種別	出願番号	公開番号	国際公開番号	登録番号	発明名称	パテントスコア	レイティング
B	1993-116310	1994-292568	—	2858066	組織培養法並びにこれに用いる培養基材	92.6	A+
B	1996-206509	1998-028597	—	3129662	皮膚刺激判定法	85.6	A+
B	1999-530558		WO1999/ 029490	3138754	ラベル用低温熱収縮性フィルム	83.7	A
B	1996-126372	1997-290865	—	3104166	生野菜包装用積層フィルム及び生野菜包装体	80.9	A
B	2003-575193		WO2003/ 077041	4033837	導電性ブラシ及び電子写真複写装置	80.2	A
B	2009-216270	2011-064985	—	4990335	中間転写ベルト	76.7	A
A	2009-181827	2011-033942	—	5058222	中間転写ベルト	76.6	A
B	2002-288562	2004-124291	—	3470120	端末編組織および該端末編組織を備えた衣類	76.6	A
B	2000-079002	2001-034418	—	4593721	タッチパネル	75.4	A
B	2010-032311	2011-168901	—	4981935	羽毛入り繊維製品用ミシン糸	74.4	A-

図表9

第3章 注目技術分野別評価

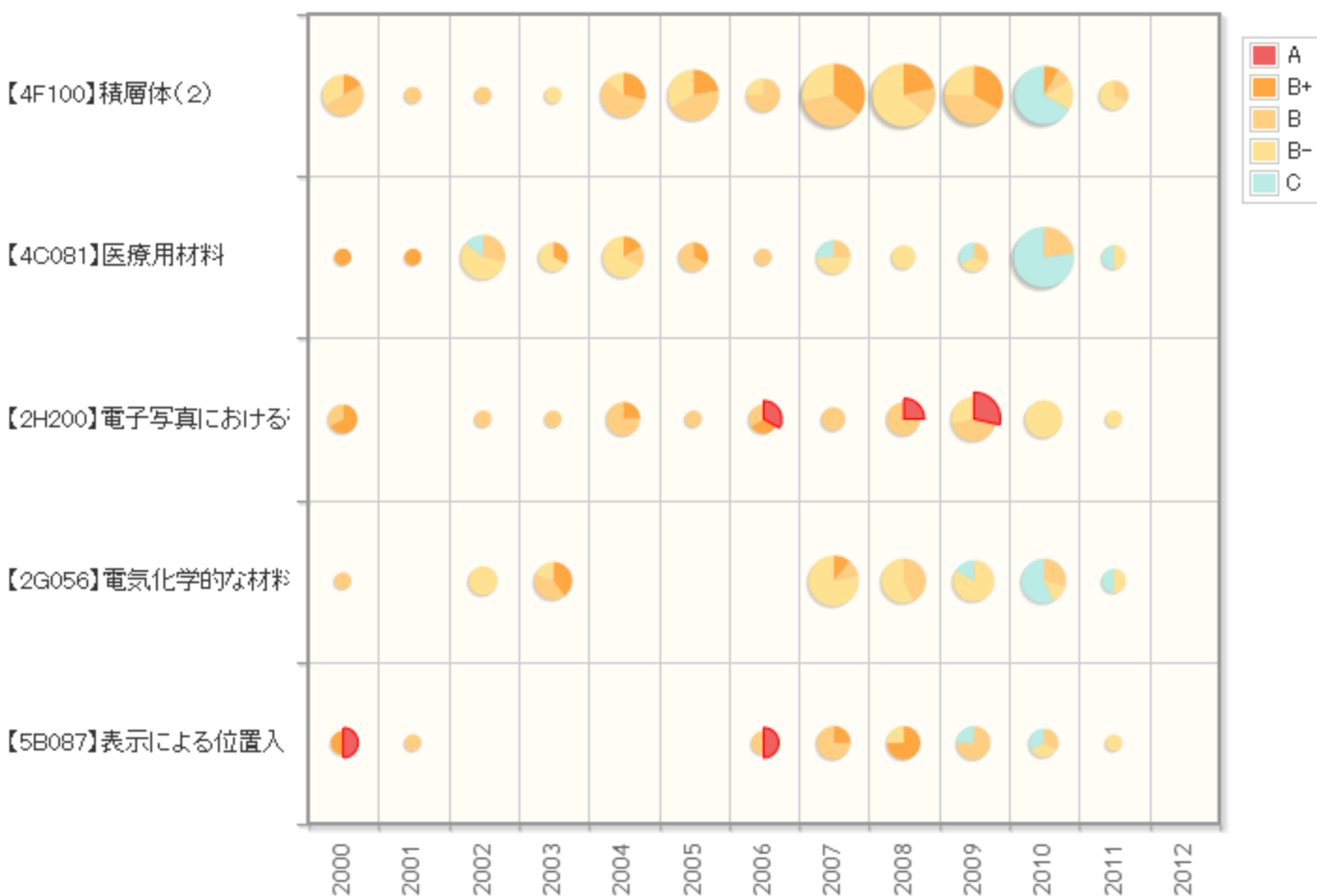
図表10は図表4および図表7における直近5年間の出願件数上位3分類および技術分類スコア上位3分類の重複を除いた合計5分類について、2008年末、2009年末、2010年末、2011年末時点及び直近における経過情報を用いて算出した技術分類スコアを用い、その推移を表したグラフである。本分析によって、経時的な変化を見ることができる。総合力(縦軸)で見ると、最も総合力の高い「4F100:積層体(2)」は過去から高い総合力を持っていたことが分かる。また、「2H200:電子写真における帯電・転写・分離」については直近の伸びが著しい。



図表10

◆注目分野の出願年別評価(筆頭テーマコード)

図表11は前述の5分類について、出願年別の評価を示したものである。グラフ内で強調表示のある箇所は特許レーティングが高評価となるA判定を示している。
 総合力で高評価となった「4F100:積層体(2)」はA評価の特許は見られていないものの比較的高評価となるB+が2007年から2009年の出願に多くみられる。「2H200:電子写真における帯電・転写・分離」は2006年以降の出願で高評価となるA判定が多数見られている。



※円の大きさは件数に比例

図表11

◆注目技術分野の経過情報の集計(筆頭テーマコード)

図表12は前述の5分類の経過情報を集計し、比較分析したものである。

注目すべき分野の特徴は以下のようになっている。

- ・「4C081:医療用材料」:他社との共同保有の特許が多い。
- ・「5B087:表示による位置入力」:パリ優先権証明書請求の割合が高く、海外への出願意欲が見られる。

分類	審査経過情報項目	全体	統層体(2) (4F100)	医療用材料 (4C081)	電子写真における帯電・転写・分離 (2H200)	電気化学的な材料の調査、分析 (2G056)	表示による位置入力 (5B087)
基本情報	総特許出願件数	2228	142	92	58	52	38
	審査請求件数	1625	112	76	44	37	29
	審査請求率	72.94%	78.87%	82.61%	75.86%	71.15%	76.32%
	登録査定件数	870	69	48	24	23	15
	登録査定率	65.86%	83.13%	73.85%	72.73%	85.19%	65.22%
	有効特許出願件数	1109	98	59	38	41	25
	有効特許出願(審査中)件数	304	29	11	11	10	6
	単独保有件数	1922	132	69	51	43	34
	共同保有件数	306	10	23	7	9	4
自社権利化意欲	審査官引用【自社】 回数(件数当たり)	182 (0.082回/件数)	21 (0.148回/件数)	15 (0.163回/件数)	4 (0.069回/件数)	1 (0.019回/件数)	3 (0.079回/件数)
	PCT国際出願 件数(割合)	62 (2.78%)	9 (6.34%)	5 (5.43%)	1 (1.72%)	2 (3.85%)	2 (5.26%)
	パリ優先権証明書提出 回数(件数当たり)	0 (0.000回/件数)	0 (0.000回/件数)	0 (0.000回/件数)	0 (0.000回/件数)	0 (0.000回/件数)	0 (0.000回/件数)
	パリ優先権証明書請求 回数(件数当たり)	213 (0.096回/件数)	17 (0.120回/件数)	12 (0.130回/件数)	12 (0.207回/件数)	2 (0.038回/件数)	21 (0.553回/件数)
	国内優先権主張 件数(割合)	184 (8.26%)	24 (16.90%)	13 (14.13%)	3 (5.17%)	5 (9.62%)	6 (15.79%)
	早期審査 件数(割合)	21 (0.94%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	2 (3.45%)	0 (0.00%)	1 (2.63%)
	分割件数 (割合)	41 (1.84%)	2 (1.41%)	1 (1.09%)	2 (3.45%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	不服審判 件数(割合)	98 (4.40%)	10 (7.04%)	10 (10.87%)	2 (3.45%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
他社牽制力	審査官引用【他社】 回数(件数当たり)	1007 (0.452回/件数)	100 (0.704回/件数)	32 (0.348回/件数)	63 (1.086回/件数)	3 (0.058回/件数)	20 (0.526回/件数)
	情報提供 回数(件数当たり)	72 (0.032回/件数)	5 (0.035回/件数)	0 (0.000回/件数)	3 (0.052回/件数)	1 (0.019回/件数)	4 (0.105回/件数)
	包袋開覽 回数(件数当たり)	490 (0.220回/件数)	49 (0.345回/件数)	11 (0.120回/件数)	22 (0.379回/件数)	4 (0.077回/件数)	7 (0.184回/件数)
	異議申立 件数(割合)	29 (1.30%)	2 (1.41%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
	無効審判 件数(割合)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

図表12

第4章 審査官引用を用いた競合企業の把握

追随企業ランキングトップ3は、日東電工、三菱樹脂、富士ゼロックス

A株式会社の全特許を対象として引用・被引用件数を集計し、**図表13,14**に示す。A株式会社は東レの公報が引用されて拒絶査定となっている公報が最も多く、35件の公報が同社の公報により拒絶査定を下されている。逆に、本分析対象公報群を引用元とし、拒絶査定が下った公報を持つ企業は、日東電工が最も多く、24件の公報を拒絶査定に導いている。

先行企業(引用数ランキング)		
	先行企業公報数	引用した公報数
自社合計	139	120
他社合計	1120	403
東レ	41	35
三井化学	24	20
東洋紡	30	19
大日本印刷	19	19
フジシールインターナショナル	18	18
凸版印刷	20	16
日東電工	19	13
カネボウ	21	12
キヤノン	14	12
帝人	12	11
パナソニック	13	10
東芝	10	9
日立製作所	9	9
コニカミノルタホールディングス	9	9
旭硝子	9	8
住友ベークライト	9	8
住友化学	9	8
旭化成	8	8
出光興産	10	7
シャープ	7	7
富士通	7	7
NEC	7	7
三菱樹脂	7	7
三菱化学	7	7
ユニチカ	7	7
日本写真印刷	6	7
信越化学工業	6	7
ワコールホールディングス	6	7

※引用公報数6件以下は多数のため省略

図表13

追随企業(被引用数ランキング)		
引用された公報数	追随企業公報数	
116	105	自社合計
492	814	他社合計
19	24	日東電工
18	23	三菱樹脂
14	23	富士ゼロックス
18	19	リコー
17	19	パナソニック
15	19	三菱化学
13	18	住友ベークライト
10	18	東洋紡
13	16	大日本印刷
12	14	凸版印刷
11	12	フジシールインターナショナル
11	11	三井化学
9	11	ブリヂストン
8	9	東レ
7	9	積水化学工業
7	8	日本ゼオン
2	8	ソニー
7	7	信越ポリマー
7	7	キヤノン
7	6	ワコール
6	6	富士フイルムホールディングス
7	5	日本写真印刷
6	5	出光興産
5	5	ダイセル
5	5	SEALED AIR
6	4	ニプロ
4	4	共同印刷
4	4	住友化学
4	4	ユニチカ
3	4	東海ゴム工業
3	4	大倉工業

※引用公報数3件以下は多数のため省略

図表14

(引用情報分析の詳細についてはp17をご参照ください)

個別公報における被引用件数第1位は「多層フィルム及びその製造法」

図表15はA株式会社の被引用件数ランキング上位公報である。
第1位は「多層フィルム及びその製造法」の17回が最も多く、以下、「偏光板用保護膜及びそれを用いてなる偏光板」および「継目のない半導電性ベルト」の9回と続く。

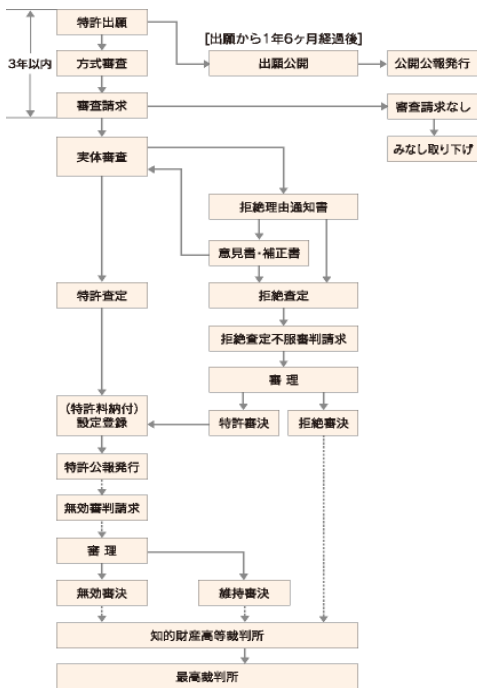
出願番号	発明名称	ステータス	被引用回数
1990-171115	多層フィルム及びその製造法	失効	17
1997-305165	偏光板用保護膜及びそれを用いてなる偏光板	権利継続	9
1989-227689	継目のない半導電性ベルト	失効	9
1998-340934	電磁波シールド用透明部材とその製造方法	権利継続	8
1995-178062	電子写真装置用無端円筒状フィルム	権利継続	8
1993-345750	半導電性ポリイミド系無端ベルトとその製造方法	失効	8
1999-228693	無端管状半導電性芳香族ポリイミドフィルムとその製造方法	権利継続	7
1999-178743	熱可逆性多色記録媒体	権利継続	7
1999-093516	半導電性ポリアミド酸組成液及びそれを用いた半導電性無端管状ポリイミドフィルム	権利継続	6
1999-530558	ラベル用低温熱収縮性フィルム	権利継続	6
1996-106157	生分解性カード基材	失効	6
1995-125531	失禁用パンツ	取下げ	6
1993-354791	導電性シームレスベルト	取下げ	6
1988-072785	透明導電膜のエッチング方法及びその装置	失効	6
2001-036063	多層熱収縮性フィルムとこれを用いた収縮性ラベルと容器	拒絶	5
1998-356858	高電磁波シールド性透明シート	拒絶	5
1997-154428	電磁波シールド用透明部材	拒絶	5
1996-334659	生分解性カード基材	失効	5
1993-018957	植毛部材	権利継続	5
1992-057612	シームレス状半導電性ベルト及びその製造方法	失効	5
1990-210984	導電性シームレスベルト	失効	5
1989-183360	熱収縮性ポリエステルフィルム	失効	5
1985-236883	低温熱収縮性の優れたポリエステル系シュリンクラベル	失効	5

図表15

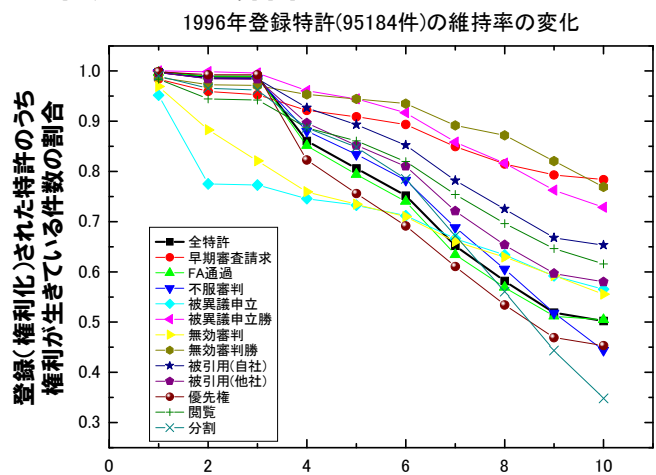
第5章 参考資料

5-1 パテントスコアについて

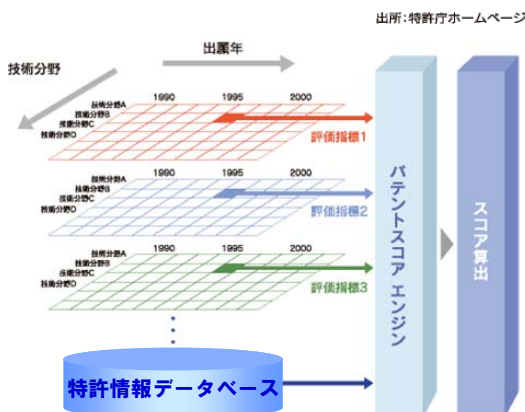
パテントスコアは、特許自動評価システムにより特許1件ごとに算出された値であり、計算には特許の審査経過情報や書誌情報といった公知情報のみを利用することで、客観的な評価を実現しました。評価対象は国内の権利化された特許および権利化の可能性のある特許全て(約300万件以上)で、自社特許の棚卸し分析や、他社保有の膨大な特許ポートフォリオのマクロ分析はもちろん、注目する各個別特許の予備評価として人的評価前のスクリーニングにも活用することができます。



パテントスコアは、特許出願後査定に至るまでの出願人・審査官・競合他社のアクション(経過情報)を同一技術分野及び出願年の特許群の中で相对比较し、相対的な偏差値として算出した値です。



※ 2007年8月末までの情報により作成

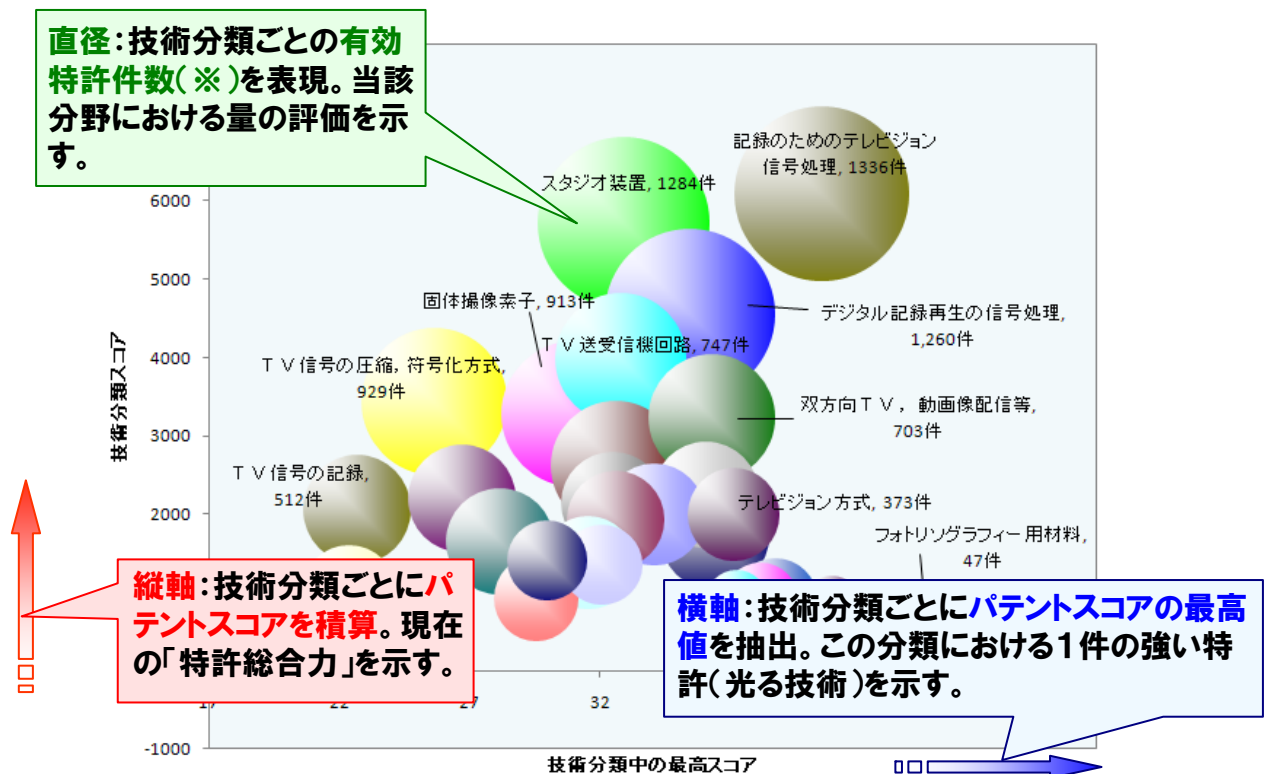


各経過情報について、特許の維持率との相関を算出し、維持率が高い審査経過情報が付与された特許ほど、よりパテントスコアが高評価となるように自動算出することで客観的な特許評価を実現しています。

また、相対評価は同一技術分野かつ同一出願年の特許群内で行うことにより、技術分野別の権利化難易度や、古い特許ほど経過情報が付与される傾向、特許審査制度の変更などの影響を緩和しています。

レーティング	C-	C	C+	B-	B	B+	A-	A	A+	A++	A+++
パテントスコア	5未満	5~15	15~25	25~35	35~45	45~55	55~65	65~75	75~85	85~95	95~105
出現率	0.0003	0.023	0.6	6.06	24.17	38.29	24.17	6.06	0.6	0.023	0.00003

5-2 技術分類スコアマップについて



本分析では、パテントスコアをベースとして、技術分類ごとの相対的な強みや特徴を、「円の大きさ」と、その「ポジション」によって可視化する「技術分類マップ」を使って評価しています。

円の大きさは「有効特許件数」を、横軸は各技術分類の特許群の中で最も得点が高い特許のスコア(「技術分類最高スコア」)を、縦軸は各企業が出願した特許群のスコアを合算した値(「技術分類スコア」)を表しています。

技術分類最高スコアは、主に技術分類における個別特許の強さ(注目度)を反映した指標であり、有効特許件数が少なく、技術分類スコアが低い分野でも、注目度の高い特許を出願していれば、横軸の高スコア領域に表示されます。

また、技術分類スコアは、各技術分類の総合的な強さを反映した指標であり、有効特許件数が少なくても、注目度の高い特許を多く保有していれば、縦軸の高スコア領域に表示されます。

※:「有効特許件数」について

失効や拒絶、取下げされていない、未審査の出願や審査中、権利継続中の”生きている特許”の件数を示します。

5-3 引用情報分析について

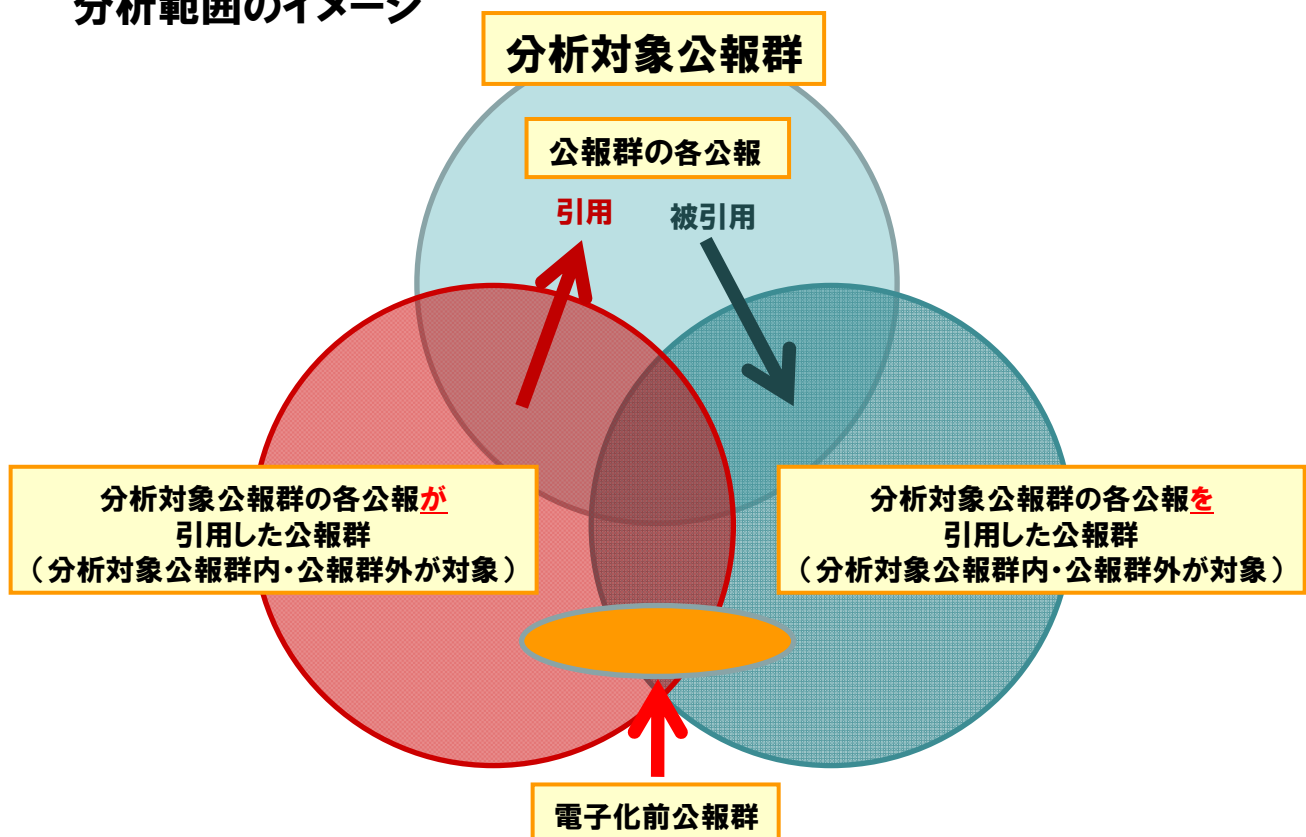
○引用情報について

- ・当分析では引用情報として、「拒絶査定時の拒絶理由として記載された文献番号」を用いています。
- ・引用回数等の集計は他の分析と同様に、全て最新の権利保持者=「権利者」で集計しています。

○分析対象データの範囲について

当分析で基点となる公報は公報群内にある公報ですが、“公報群内の公報が引用した公報”、及び、“公報群内の公報を引用した公報”については、**公報群外の公報も分析の対象**としています。また、電子化前の公報も分析対象としています。

分析範囲のイメージ



○各ランキングについて

- ・先行企業(引用数ランキング)・・・公報の権利化を**阻害している**企業ランキング
 先行企業公報数: 引用元となっている特許件数。分析対象特許以外の特許も含む。
 拒絶された公報数: 「先行企業公報」を引用元として拒絶された特許件数。分析対象特許のみが対象。
- ・追随企業(被引用数ランキング)・・・公報の権利化を**阻害されている**企業ランキング
 引用された公報数: 「追随企業公報」を拒絶査定に至らせた引用元となる特許件数。
 分析対象特許以外の特許も含む。
 追随企業公報数: 拒絶された特許件数。分析対象特許のみが対象。

5-4 分析に用いたツール「BizCruncher」について

BizCruncher

BizCruncherは、特許の検索・閲覧・分析までの一連の作業を簡易な操作で可能にすることで、ユーザーの特許情報へのアクセスを容易にし、さらに特許情報の戦略的活用を支援するWebサービス(ASPサービス)です。



特徴

- ① 簡単 専門的知識が無くても**高度な分析**が可能
 - ・お使いのブラウザからアクセスするだけで始められます
- ② 快適 思考の流れを止めない**優れた操作性**を実現
 - ・クリックするだけで分析を進められます
- ③ 多彩な分析 ユーザーの目的に応える**各種分析機能**を搭載

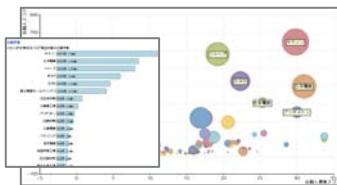
本レポートは全てBizCruncherを用いて行っております

<http://www.bizcruncher.com>

◆分析コンテンツ

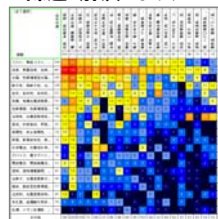
検索・閲覧・分析をシームレスに連携させることで、**精度の高い特許分析をストレスなく実行**できます。

➢ 権利者/出願人スコアマップ・技術分類マップ



分析対象特許群における権利者・出願人別または技術分類別ポジションを明らかにします。

➢ 課題・解決マトリクス



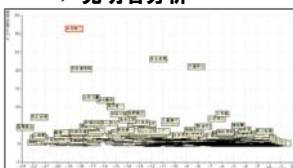
課題と解決手段から、調査対象の出願傾向を把握します。

➢ 引用分析



拒絶査定に至った特許公報の引用情報から、重要特許・競合企業の把握ができます。

➢ 発明者分析



特定技術・企業におけるキーマンを明らかにします。

➢ ステータス分析



現在のステータス状況や、ステータス別件数の推移を把握できます。

- その他各種分析
 - ・アライアンス分析
 - ・レイティング
 - ・製品分類
 - など

- 検索機能
 - ・類似特許検索
 - ・類似特許マップ
- 公報閲覧機能
 - ・請求項構造図
 - ・請求項概要図
 - ・キーワード自動ハイライト

—取扱規程—

1. 本レポートは、日本国特許庁より公開された特許情報のみを情報源としますが、記載内容には当該公開情報をもとに弊社独自の手法により数学的・統計的に処理された秘密情報を含んでおり、当該情報に関する一切の権利は弊社に帰属します。したがって、貴社(殿)の内部資料としてのみご利用いただくこととし、本レポートの内容を第三者に漏洩することを禁止します。
2. 本レポートの著作権は弊社に帰属します。本レポートの全部もしくは一部を引用または複製、貸与、翻訳、転載・転用その他弊社の著作権を侵害する行為は一切禁止します。
3. 万一、貴社(殿)が前各項の定め違反して本レポートの内容を第三者に漏洩したため、弊社に対し何らかの紛議が生じ、もしくは貴社(殿)が弊社の著作権を侵害し、これによって弊社が損害を被ったときは、その損害は貴社(殿)に賠償していただきます。
4. 前項の損害賠償に関して貴社(殿)と弊社の間には訴訟の必要が生じたときは東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
5. 弊社は、本レポートの内容について損害賠償の責を負いません。

—確認事項—

本レポートに記載された企業・団体または個人及び特許に関する情報は、後述の日本国特許庁により発行された公開済みの各種公報等より得られる情報ならびに当該情報を所定の方法によって数学的・統計的に処理することによって得られる情報のみに限定していること、また、直接間接を問わず本レポートに係わる特定の企業・団体または個人などから、当該情報記載の対価としていかなる報酬も受領していないことを確認します。

—留意事項—

1. 本レポートの作成に用いた特許情報は、日本国特許庁により発行された下記の電子化された公報にのみ準拠しています。したがって、対象期間外に発行された公報及び電子化されていない公報に関する情報は一切考慮しておりません。(例えば、調査対象の企業・団体または個人の特許出願について 1992 年 12 月以前に発行された公開特許公報が存在している場合も本レポートには反映されません。)

公開特許公報	:1993年1月～2012年9月
特許公告公報	:1994年1月～1996年3月
特許公報	:1996年5月～2012年9月
再公表特許公報	:1996年1月～2012年9月
公表特許公報	:1996年1月～2012年9月
整理標準化データ	:～2012年9月
(特許庁データ作成日)	

2. 本レポートは、弊社が利用契約者様への情報提供のみを目的として作成したものであり、特定の有価証券等の取引および特定の企業・団体または個人との取引を推奨または勧誘する目的で提供されるものではありません。
3. 本レポートに記載されているデータ、情報等は弊社が公に入手可能な情報に基づき作成したものではありませんが、弊社はその正確性、完全性、情報の妥当性等を保証するものではなく、また、当該データ、情報等を使用した結果についてもなんら補償するものではありません。また、ここに記載された内容は事前の予告なく変更されることがあります。
4. 弊社は、本レポートにおいて、利用契約者様に対して、特定の投融資等取引の妥当性の評価や、特定の投融資等取引についての潜在的な価値またはリスクの判断等を行うものではありません。
5. 弊社はいかなる場合においても、本レポートを提供した利用契約者様(本レポートの第三者への提供は取扱規則により禁止されておりますが、当該規則にかかわらず故意または過失により本レポートを受け取った第三者を含む)に対して、本レポートの使用に直接または間接的に起因したと思われる損害等(本レポートの使用上の誤り、あるいは本レポートの内容の脱落または誤りによるものを含む)について、損害賠償を負うものではなく、利用契約者様の弊社に対する賠償請求権は明示的に放棄されていることを前提とします。

特許・技術調査レポート
Patent & Technology Research Report
特許ポートフォリオ分析
「A株式会社」
2012.11

◆お問い合わせ先: 株式会社パテント・リザルト

E-mail: info@patentresult.co.jp

tel 03-5835-5644 fax 03-5835-5699

◎本誌の全ての部分に関する一切の権利は、株式会社パテント・リザルトに帰属しており、方法の如何に関わらず、いかなる目的においても、無断での転用または転載、複製、抄録、翻訳載、磁気媒体または光ディスク等への入力等を禁止致します。

株式会社パテント・リザルト

〒111-0053

東京都台東区浅草橋 5-3-2 秋葉原スクエアビル 4 階 <http://www.patentresult.co.jp/>